

습식 에칭용 6인치 Ptfе 웨이퍼 세정 랙 내산성 알칼리 내성 불소중합체 웨이퍼 캐리어

품목 번호: PL-CP421



소개

강력한 습식 에칭 공정을 위해 설계된 고순도 6인치 PTFE 웨이퍼 세정 랙입니다. 이 내산성 불소중합체 캐리어는 반도체 제조, 고정밀 실험실 미량 분석 응용 분야 및 화학 공정에서 뛰어난 화학적 안정성과 초저오염 특성을 제공합니다.

자세히 알아보기

적용 분야	설명	주요 이점
반도체 습식 에칭	HF, BOE 또는 열인산조에서 실리콘 웨이퍼 공정	금속 오염을 방지하고 강력한 화학물질에 견딥니다.
대량전지 제조	광전지 생산용 실리콘 기판 세정 및 텍스처링	대량 생산에 적합한 내구성과 알칼리성 텍스처링 용액에 대한 내성
미량 금속 분석	ICP-MS 분석 전 실험실 유리 기구 및 기판 세정	초저 배경 수준과제로 이온 침출로 정확한 데이터를 제공합니다.
MEMS 제조	심부 반응성 이온 에칭 또는 습식 릴리스 공정 중 미세전자기계시스템 핸들링	깨지기 쉬운 구조에 고치수 정밀도로 섬세한 핸들링을 제공합니다.
화학 기상 증착	고품질 박막 성장을 위한 기판 전처리 세정	전처리 산에 견터 원자 단위 깨끗한 표면을 보장합니다.
제약 세정	제약 R&D에서 고순도 부품의 멸균 및 세정	멸균제에 대한 우수한 내성을 가진 FDA 준수 소재
전기도금 공정	산 또는 알칼리조에서 정밀 금속 증착 중 기판 고정	전기 절연성과 도금 전해질에 대한 완전한 내성

사양 카테고리	PL-CP421 세부 사항
모델 번호	PL-CP421
기본 소재	고순도 버진 PTFE (요청 시 PFA/TFM 제공 가능)
기본 웨이퍼 직경	표준 6인치(150mm)
웨이퍼 용량	완전 사용자 정의 가능 (예: 25슬롯, 50슬롯 또는 맞춤 갯수)
슬롯 너비/피치	기판 두께와 간격 요구사항에 맞춰 사용자 정의 가능
핸들 디자인	고정형, 분리형 또는 연장형 (조 길이에 맞춰 맞춤 제작)
내온 성	-200°C ~ +260°C (-328°F ~ +500°F)
제조 방식	5축 정밀 CNC 가공
표면 조도	Ra < 0.8μm (표준) 또는 맞춤 연마
화학 적합성	용융 알칼리 금속과 원소 불소를 제외한 범용 적합
적합성	반도체 등급 / 미량 분석 등급